

## Bâti de gravure plasma R.I.E. (Reactive Ion Etching)



- ✓ Gravure plasma
- ✓ Activation de surface (créer des liaisons pendantes)
- ✓ Lignes de gaz Oxygène et CF<sub>4</sub>

*Exemple de réalisations : Guides optiques et microcavités laser*

### **Caractéristiques**

- Marque : Plasma Technology
- Type : Plasmalab μP
- Temps d'attaque programmables.
- Gaz Oxygène seulement.
- Puissance RF ajustable : 27 à 100W.